

利用課題番号 : F-13-WS-0076
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : ITO 電極のエキシマーUV による基板表面処理
Program Title (English) : Surface treatment of ITO electrode using excimer UV method
利用者名 (日本語) : 松波成行
Username (English) : Shigeyuki Matsunamim
所属名 (日本語) : ソニー株式会社
Affiliation (English) : Sony Co., Ltd.

1. 概要 (Summary) :

有機半導体向けの ITO 基板は、有機層を形成する前工程として、一般的に UV オゾン法や種々のプラズマガスによる表面処理が通常行われている。導入するガス種にも依存するものの、主には活性化された酸素によって電極表面に付着している炭素成分を気化 (CO₂化) させて除去する機構に基づいている。

エキシマーUV 法も表面処理の効果的な工程としてその有用性が知られている。本検討においては、貴学のエキシマーUV 装置を用い、特に ITO 基板の表面処理・表面改質について知見を得ることを相談した。

上記の検討をするにあたり、大気プラズマや減圧下 Ar プラズマによる方法を試したが、期待通りの効果を得ることが出来なかったために他の方法が無いかということで相談を行った。応用デバイスについては企業の秘密上、今回は伏せている。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。